

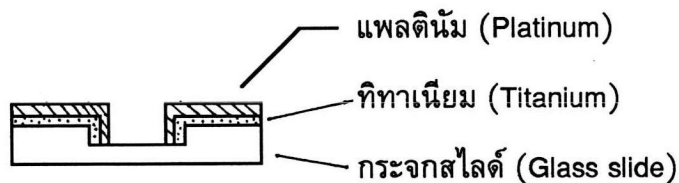
## บทที่ 4

### การประดิษฐ์เครื่องหลอมเซลล์ด้วยไฟฟ้า

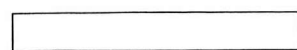
ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของการประดิษฐ์เครื่องหลอมเซลล์ซึ่งมีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 คือ 1. ห้องบรรจุเซลล์ 2. ส่วนสร้างคลื่นไฟฟ้า 3. ส่วนขยายภาพและแสดงผล

#### ห้องบรรจุเซลล์ (chamber)

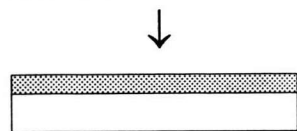
ห้องบรรจุเซลล์ในระบบเครื่องหลอมเซลล์ด้วยไฟฟ้าที่ใช้ในงานวิจัยนี้ประดิษฐ์ขึ้นจากกระจกสไลด์ที่ทำให้เป็นร่องเพื่อบรรจุเซลล์ ด้านบนของห้องบรรจุเซลล์จะมีฟิล์มบางของโลหะที่ใช้ทำเป็นขั้วอิเล็กโทรดซึ่งจะมีสายต่อเชื่อมโยงเข้ากับวงจรกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าเพื่อนำสัญญาณไฟฟ้าเข้ามาใช้ในการหลอมเซลล์ โครงสร้างของห้องบรรจุเซลล์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมีโครงสร้างดังรูปที่ 4.1 และมีขั้นตอนการประดิษฐ์ดังรูปที่ 4.2



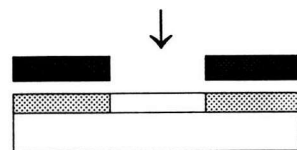
รูปที่ 4.1 โครงสร้างของห้องบรรจุเซลล์



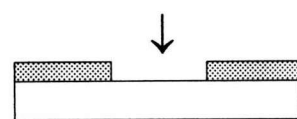
ล้างแผ่นกระจกสไลด์



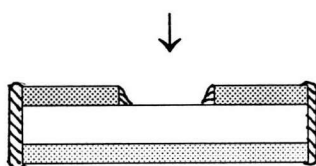
ติดฟิล์มโฟโตรีซิส  
(เบอร์ 6000)



ฉายแสงอัลตราไวโอเล็ตผ่าน  
แผ่นฟิล์มที่มีรูปแบบตามต้องการ



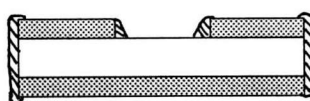
ล้างฟิล์มโฟโตรีซิสส่วนที่ถูก  
แสงออก



ติดฟิล์มโฟโตรีซิสด้านล่างกระจก  
และเคลือบบริเวณขอบกระจก  
ด้วยโฟโตรีซิสแบบเนกาทีฟ  
(OMR 83)



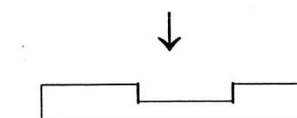
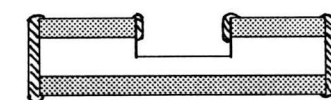
อบที่ 80°C 15 นาที



ฉายแสงอัลตราไวโอเล็ต  
เพื่อทำให้โฟโตรีซิสแข็งตัว  
อบที่ 80 ° C 15 นาที



นำไปกัดด้วยสารละลายกรด  
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ 10%



ล้างโฟโตรีซิส ส่วนที่เหลือออก  
ด้วยอะซิโตน

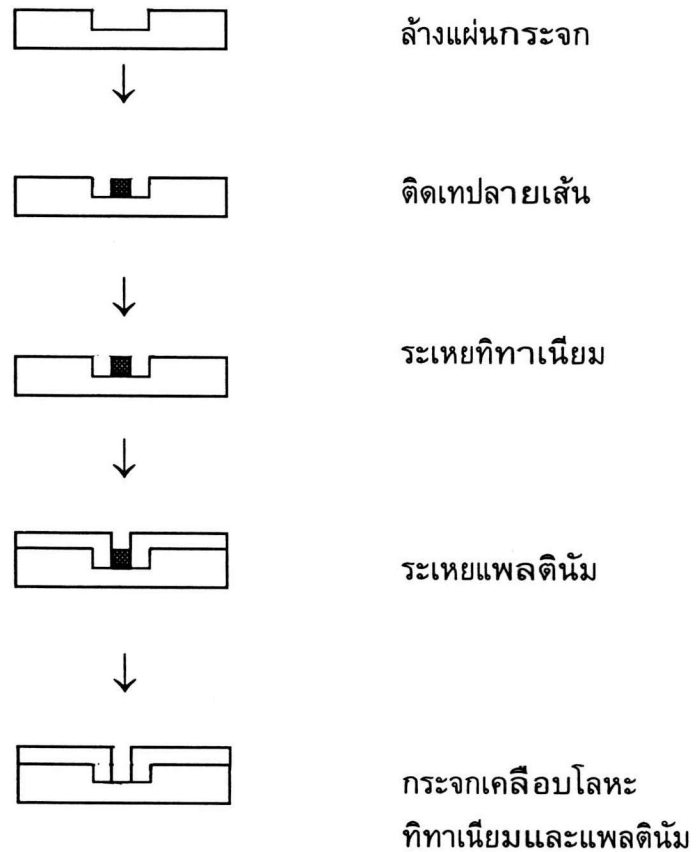
รูปที่ 4.2 ขั้นตอนการประดิษฐ์ห้องบรรจุเซลล์

จากขั้นตอนในรูปที่ 4.2 กระจกสไลด์จะถูกล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำปอลดออิออน(DI) 2 ครั้ง หลังจากนั้นทำการล้างด้วยสารละลายอะซิโตนและไตรคลอโรเอทิลีน ในเครื่องทำความสะอาด(Sonicator) สารละลายละ 15 นาที และล้างซ้ำด้วยสารละลายอะซิโตน และเอทิลแอลกอฮอล์ สารละลายละ 5 นาทีในเครื่องโซนิกเคเตอร์เช่นกัน

กระจกสไลด์ที่ล้างสะอาดดีแล้วจะนำไปทำแบบร่องด้วยเทคนิคโฟโตลิโทกราฟี โดยนำกระจกมาติดฟิล์มโพโตรีซิส(Morton no. 6000) เพื่อใช้ทำเป็นแบบร่อง และใช้เป็นหน้ากาก(Mask) สำหรับป้องกันการกัดเซาะของสารละลายกรดไฮโดรเจนฟลูออไรด์ 10 % หลังจากนั้นจะนำไปฉายแสงอัลตราไวโอเล็ตและล้างฟิล์มโพโตรีซิสออก(Develop)

หลังจากนั้นติดฟิล์มโพโตรีซิส และเคลือบบริเวณขอบฟิล์มโพโตรีซิสด้วยโพโตรีซิสที่เป็นสารละลาย(OMR 83)อีกครั้ง เนื่องจากโพโตรีซิส OMR 83 จะติดแผ่นกระจกได้ดีกว่าฟิล์มโพโตรีซิส จึงช่วยป้องกันการหลุดลอกของฟิล์มโพโตรีซิสขณะทำการกัดด้วยสารละลายกรดไฮโดรเจนฟลูออไรด์ 10 % หลังจากนั้นนำกระจกที่ติดฟิล์มแล้วไปกัดเซาะร่องด้วยสารละลายไฮโดรเจนฟลูออไรด์ 10 % เป็นเวลา 5 ชั่วโมง (อัตราการกัดกระจกแสดงในภาคผนวก) แล้วล้างฟิล์มโพโตรีซิสออกด้วยสารละลายอะซิโตน(โพโตรีซิส OMR 83 จะหลุดออกไปและอาจมีบางส่วนที่ติดอยู่ ใช้ปากคิบบที่สะอาดหยิบออก) ได้ร่องที่มีความลึกประมาณ 200  $\mu\text{m}$

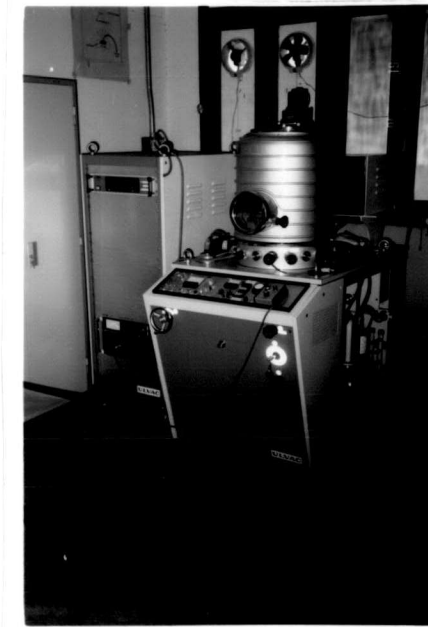
กระจกที่ผ่านการกัดเซาะร่องแล้วจะนำไปทำการติดขั้วโลหะโดยทำการล้างกระจกอีกครั้งด้วยสารละลายอะซิโตน และไตรคลอโรเอทิลีน ในเครื่องโซนิกเคเตอร์ สารละลายละ 15 นาที และล้างซ้ำด้วย สารละลายอะซิโตน และเอทิลแอลกอฮอล์ สารละลายละ 5 นาที ในเครื่องโซนิกเคเตอร์เช่นกัน จากนั้นจึงนำเทปลายเส้นมาติดทับลงบนกระจกที่ได้แล้วนำไปเคลือบด้วยโลหะทิกทานีเยมและแพลตินัมเพื่อทำเป็นขั้วโลหะ โดยมีขั้นตอนการทำแสดงในรูปที่ 4.3



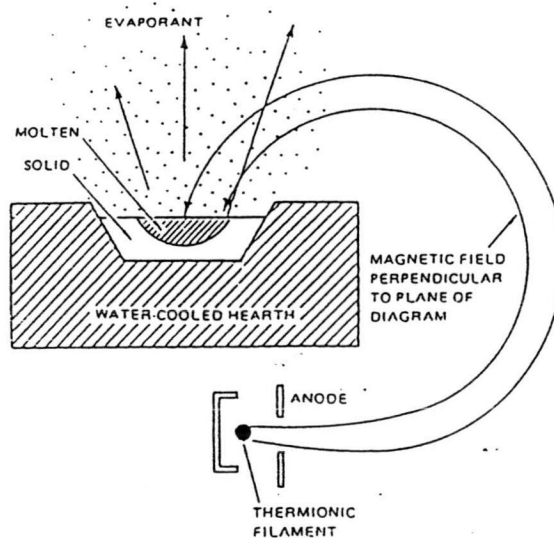
รูปที่ 4.3 ขั้นตอนการทำขั้วโลหะ

การเคลือบโลหะแพลตินัมและทิตาเนียมทำโดยใช้เครื่องระเหยโลหะแบบลำอิเล็กตรอน (electron beam evaporator) ยี่ห้อ ULVAC ดังในรูปที่ 4.4 การทำงานของเครื่องระเหยโลหะแบบลำอิเล็กตรอนมีหลักการทำงานอธิบายได้ดังรูปที่ 4.5 โดยสารที่จะระเหย (evaporant) จะถูกวางอยู่ในเบ้าทองแดง (crucible) แผ่นฐาน (substrate) ที่ต้องการเคลือบจะยึดติดกับตัวยึด (holder) ซึ่งอยู่ด้านบนของเบ้า ส่วนประกอบที่กล่าวไปทั้งหมดจะอยู่ภายในฝาครอบ (bell jar)





รูปที่ 4.4 เครื่องระเหยโลหะแบบลำอิเล็กตรอน



รูปที่ 4.5 หลักการทำงานของเครื่องระเหยโลหะแบบลำอิเล็กตรอน

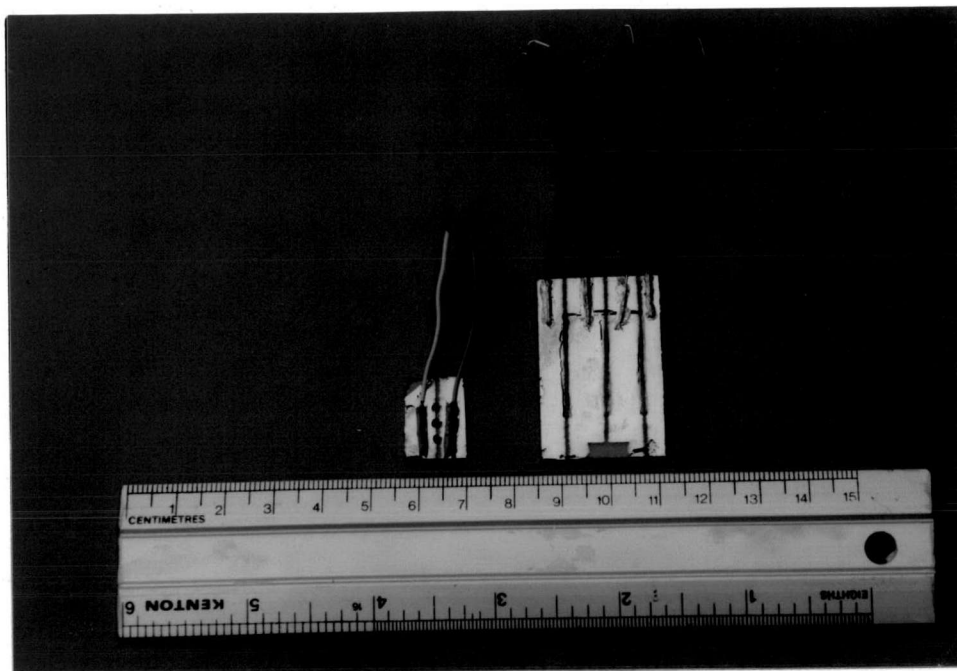
การทำงานของเครื่องระเหยโลหะแบบลำอิเล็กตรอนจะทำภายใต้ความดันในช่วงระหว่าง  $2 \times 10^{-6}$  torr ถึง  $5 \times 10^{-6}$  torr (สำหรับการระเหยโลหะที่เทเนียมและแพลตินัม) เริ่มจากการดูดอากาศออกด้วยปั๊มสุญญากาศจนกระทั่งได้ความดันเพียงพอ ลำอิเล็กตรอนจะ

ถูกโฟกัสไปยังโลหะจนกระทั่งโลหะกลายเป็นไอและระเหยไปติดยังแผ่นฐาน (กระจกสไลด์ที่ทำเป็นร่อง)ที่อยู่ด้านบนของเบ้าโลหะ ในการเคลือบโลหะจะเคลือบทีทาเนี่ยมลงไปก่อนเพื่อทำหน้าที่เป็นชั้นเชื่อมประสานให้แพลตินัมเกาะติดแผ่นฐานได้เป็นอย่างดี จากนั้นจะเคลือบแพลตินัมอีกชั้นหนึ่งแล้วจึงนำไปต่อกับสายไฟเพื่อต่อเป็นขั้วโลหะระหว่างร่องของห้องบรรจุเซลล์

ในการระเหยโลหะนี้ใช้โลหะทีทาเนี่ยมมีความบริสุทธิ์ 99.99 % ส่วนทองขาวที่ใช้มีความบริสุทธิ์ 99.5 % ภาวะที่ใช้ระเหยโลหะทั้งสองชนิด แสดงในตารางที่ 4.1 หลังจากระเหยโลหะลงบนกระจกแล้วจะได้ห้องบรรจุเซลล์ดังแสดงในรูปที่ 4.6

ตารางที่ 4.1 ภาวะที่ใช้ในการระเหยโลหะแบบลำอิเล็กตรอน

เงื่อนไข	ทีทาเนี่ยม	แพลตินัม
thickness ( $^{\circ}$ A)	1000	1500
back pressure (torr)	$2 \times 10^{-6}$	$5 \times 10^{-6}$
substrate temperature( $^{\circ}$ c)	20-25	20-25
deposition rate ( $^{\circ}$ A/s)	0.0-1.3	0.5-1.2
rotation speed (r/min)	2	2
emission control	60	72
current emission (mA)	15-20	90-120
calibration parameter for thickness monitor :		
density ( $\text{g/cm}^3$ )	4.5	21.4
Z-ratio	0.628	0.245
tooling (%)	60	60



รูปที่ 4.6 กระดาษสไลด์ที่ผ่านขั้นตอนต่างๆ จนได้ห้องบรรจุเซลล์ที่สมบูรณ์

เมื่อได้ห้องบรรจุเซลล์แล้ว ในงานวิจัยนี้ได้นำห้องบรรจุเซลล์ที่ประดิษฐ์ไปทดสอบการหลอมเซลล์ด้วยไฟฟ้ากับเซลล์มะเร็งหนู(NS-1) จะกล่าวต่อไปในบทที่ 5

### ส่วนสร้างคลื่นไฟฟ้า

ส่วนสร้างคลื่นไฟฟ้าจะประกอบด้วย 2 ส่วนที่สำคัญคือ ส่วนกำเนิดสัญญาณคลื่นรูปไซน์ (Sine wave generator) และส่วนกำเนิดสัญญาณคลื่นรูปพัลส์(Pulse generator) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 1. ส่วนกำเนิดสัญญาณคลื่นรูปไซน์ (Sine wave generator)

ในการหลอมรวมเซลล์ด้วยไฟฟ้านั้นเซลล์จะเข้ามาเรียงตัวกันรูปลูกโซ่เมื่อกระตุ้นด้วยสัญญาณคลื่นรูปไซน์ ตัวแปรที่ต้องพิจารณาสำหรับสัญญาณคลื่นรูปไซน์คือความถี่(Frequency) และสนามไฟฟ้า (Electric field)

จากการพิจารณาการหลอมเซลล์ด้วยไฟฟ้าของเซลล์ชนิดต่างๆ ในตารางที่ 1.1 ที่กล่าวมาในบทที่ 1 Vienken and Zimmermann (1982) ได้รายงานการกระตุ้นเซลล์ให้มาเรียงกันด้วยสัญญาณคลื่นรูปไซน์โดยใช้สนามไฟฟ้า 100 V/cm ความถี่ 1 MHz เพื่อทำการหลอมเซลล์

จากการพิจารณาการหลอมเซลล์ด้วยไฟฟ้าของเซลล์ชนิดต่างๆ ในตารางที่ 1.1 ที่กล่าวมาในบทที่ 1 Vienken and Zimmermann (1982) ได้รายงานการกระตุ้นเซลล์ให้มาเรียงกันด้วยสัญญาณคลื่นรูปไซน์โดยใช้สนามไฟฟ้า 100 V/cm ความถี่ 1 MHz เพื่อทำการหลอมเซลล์มะเร็งหนูกับเซลล์ลิมโฟซัยท์ นอกจากนี้ Vienken et. al (1983) ได้รายงานการกระตุ้นเซลล์ของเซลล์มะเร็งหนู(SP2 กับ X63 ) โดยใช้สนามไฟฟ้า 200 V/cm ความถี่ 800 kHz ในงานวิจัยนี้จะใช้เซลล์มะเร็งหนู(NS-1)เป็นเซลล์ต้นแบบ ซึ่งจากข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งหนูให้มาเรียงตัวกันควรจะใช้สนามไฟฟ้าในช่วง 100 - 200 V/cm และความถี่ในช่วง 800 kHz - 1 MHz

ในงานวิจัยได้ใช้เครื่องกำเนิดสัญญาณคลื่นรูปไซน์ (Wavetex model 180, USA) โดยเครื่องดังกล่าวนี้สามารถสร้างคลื่นรูปไซน์มีค่าแรงดันสูงสุด 20 V เมื่อใช้ความถี่ 1 MHz และเมื่อต่อเข้ากับความต้านทานขนาด 1 M $\Omega$  (ใช้แทนโหลดของห้องบรรจุเซลล์) จะทำให้ค่าแรงดันลดลงเป็น 8 V การที่ต่อโหลด ด้วยความต้านทาน 1 M $\Omega$  แล้วแรงดันขาเข้าลดต่ำลงคาดว่าเกิดจาก เครื่องกำเนิดสัญญาณคลื่นรูปไซน์ไม่สามารถจ่ายกระแสได้เพียงพอจึงทำให้ค่าแรงดันขาเข้าลดลงเหลือ 8 V เนื่องจากห้องบรรจุเซลล์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมามีระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดเท่ากับ 2 mm ดังนั้นจะได้สนามไฟฟ้าเมื่อยังไม่ขยายสัญญาณเท่ากับ 40 V/cm แต่การกระตุ้นเซลล์ให้มาเรียงตัวกันของเซลล์มะเร็งของหนู กับเซลล์อื่นๆ จะใช้สนามไฟฟ้าในช่วง 100 - 250 V/cm และความถี่ในช่วง 800 kHz - 1 MHz ดังนั้นในระบบเครื่องหลอมเซลล์ด้วยไฟฟ้า จะต้องเพิ่มส่วนขยายสัญญาณคลื่นรูปไซน์ให้กับเครื่องกำเนิดสัญญาณคลื่นรูปไซน์ โดยการนำหม้อแปลงเพิ่มแรงดันมาต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดสัญญาณคลื่นรูปไซน์ หลังจากต่อทั้งสองส่วนที่กล่าวมาแล้ว นำไปวัดค่าแรงดันก่อนและหลังการขยายด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า ได้ผลการทดลองดังแสดงในรูปที่ 4.7 และตารางที่ 4.2



ก่อนการขยายสัญญาณ

หลังจากขยายสัญญาณ

รูปที่ 4.7 สัญญาณคลื่นรูปไซน์ที่ผ่านการขยายด้วยหม้อแปลงเพิ่มแรงดันในขณะต่อโหลด

สเกลแรงดัน = 10 โวลต์/ช่อง

สเกลเวลา = 1  $\mu$ s/ช่อง

ตารางที่ 4.2 แรงดันขาเข้าและขาออกจากส่วนขยายสัญญาณคลื่นรูปไซน์

โหลด	แรงดันขาเข้า(V in) (โวลต์)	แรงดันขาออก(V out) (โวลต์)	อัตราขยาย (เท่า)
$\infty$	20	80	4
1 M $\Omega$	8	50	6.25

ข้อสังเกต การที่อัตราขยายในขณะที่มีโหลด มีค่าสูงกว่าในขณะที่ไม่มีโหลดนั้น ได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผลจากปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ เนื่องจากตัวเหนี่ยวนำของหม้อแปลงและตัวเก็บประจุของโหลด

จากผลการทดลองในตารางที่ 4.2 เมื่อต่อส่วนขยายสัญญาณคลื่นรูปไซน์แล้วพบว่าสามารถเพิ่มแรงดันขาออกโดยมีอัตราขยายของแรงดันสัญญาณคลื่นรูปไซน์เท่ากับ 4 และ 6.25 เท่า ซึ่งแรงดันที่จะนำไปใช้งานคือแรงดันขาออก 50 V ดังนั้นจะได้สนามไฟฟ้า 250 V/cm (ระยะห่างของขั้ว = 2 mm) ซึ่งคาดว่าเพียงพอที่จะกระตุ้นเซลล์ให้มาเรียงตัวกันได้

เมื่อต่อส่วนขยายคลื่นรูปไซน์กับเครื่องกำเนิดฟังก์ชันแล้วจะนำไปประกอบกับส่วนวงจรกำเนิดสัญญาณพัลส์ ที่จะกล่าวในหัวข้อ 4.3 ต่อไป

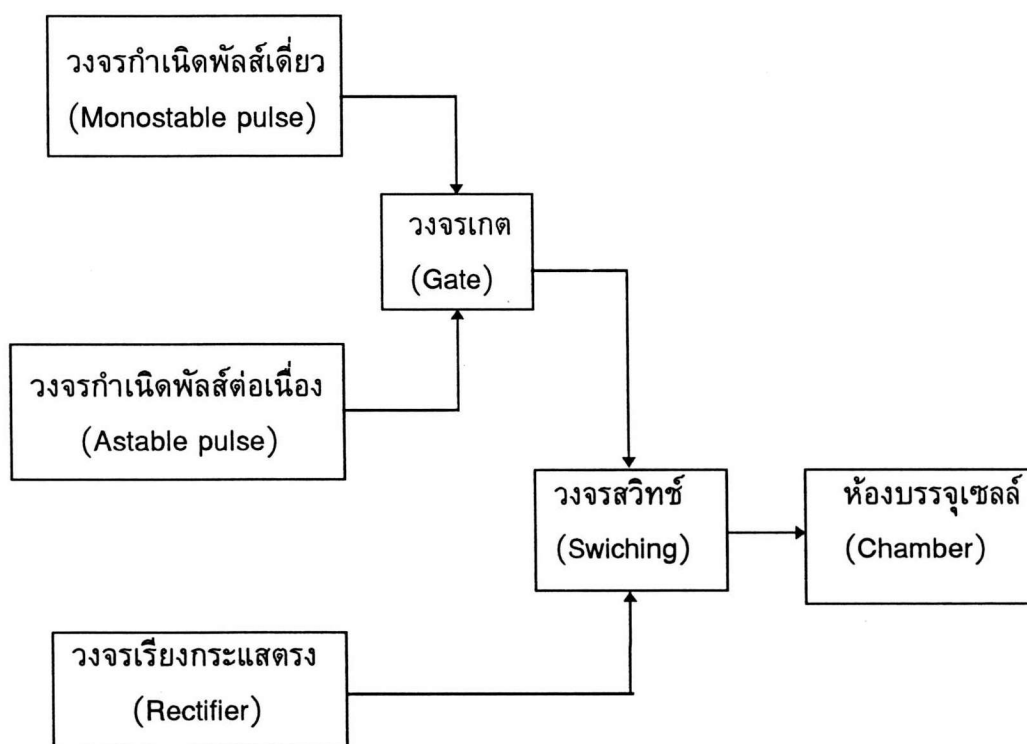
## 2. ส่วนกำเนิดสัญญาณคลื่นรูปพัลส์

ได้ทำการประดิษฐ์วงจรกำเนิดสัญญาณคลื่นรูปพัลส์ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

- 1) วงจรกำเนิดสัญญาณพัลส์ต่อเนื่อง (Continuous pulse generator)
- 2) วงจรกำเนิดสัญญาณพัลส์เดี่ยว (Monostable pulse generator)
- 3) วงจรเกต (Gate)
- 4) วงจรเรียงกระแสตรง (Rectifier)
- 5) วงจรสวิตช์ (Swiching)
- 6) แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

โดยวงจรต่างๆที่จะนำมาประกอบกันสามารถเขียนเป็นรูปบล็อกไดอะแกรมได้ดังรูปที่

4.8 และรูปที่ 4.9 แสดงผังวงจรไฟฟ้ารวม



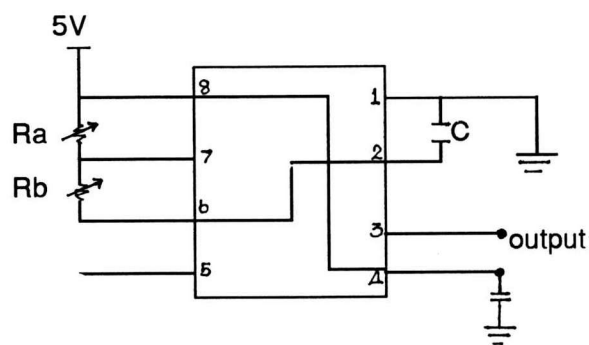
รูปที่ 4.8 บล็อกไดอะแกรมของวงจรถ่ายกำเนิดสัญญาณคลื่นรูปพัลส์





จากรูปที่ 4.8 และ 4.9 การทำงานของวงจรในแต่ละส่วนเป็นดังนี้

1. วงจรกำเนิดสัญญาณพัลส์ต่อเนื่อง (Continuous pulse generator) เป็นวงจรที่สร้างสัญญาณคลื่นรูปพัลส์แบบต่อเนื่อง โดยจะมีสัญญาณคลื่นรูปพัลส์ออกมาตลอดเวลาและสามารถปรับความกว้างของสัญญาณพัลส์ได้ในช่วง 5-20  $\mu\text{s}$  ไอซีที่นำมาใช้งานคือ LM 555 โดยต่อให้ทำงานแบบ Astable Mode ดังแสดงในผังวงจรไฟฟ้าในรูปที่ 4.10 ค่าความกว้างของสัญญาณขาออก คือ T1 และ T2 นั้นสามารถกำหนดได้ด้วยตัวต้านทาน  $R_a$  และ  $R_b$  และตัวเก็บประจุที่มาต่อภายนอกตามสมการที่ 4.1 และ 4.2



รูปที่ 4.10 ผังวงจรไฟฟ้าสัญญาณพัลส์ต่อเนื่องของ LM 555

$$T1 = 0.693 (R_a + R_b)C \quad (4.1)$$

$$T2 = 0.693 (R_b)C \quad (4.2)$$

เมื่อ T1 คือ ความกว้างของพัลส์ขณะมีแรงดัน (output high )

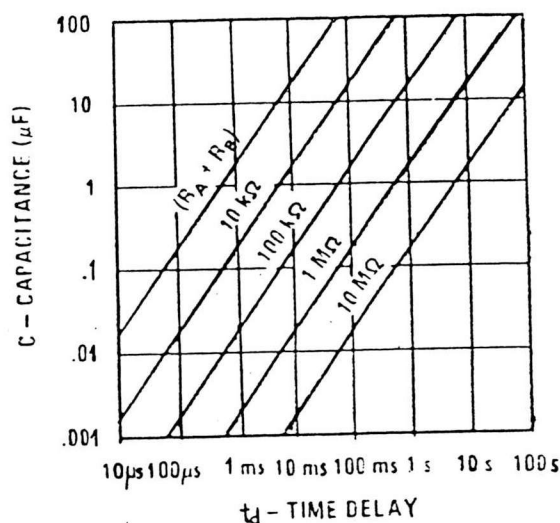
T2 คือ ความกว้างของพัลส์ขณะไม่มีแรงดัน (output low)

$R_a$  และ  $R_b$  คือ ค่าความต้านทานภายนอกที่นำมาต่อกับวงจร

C คือ ค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุภายนอก

จากสมการ 4.1 และ 4.2 สามารถหาค่า C ที่เหมาะสมโดยการแทนค่า T1 และ T2 ที่

ต้องการจากกราฟรูปที่ 4.11

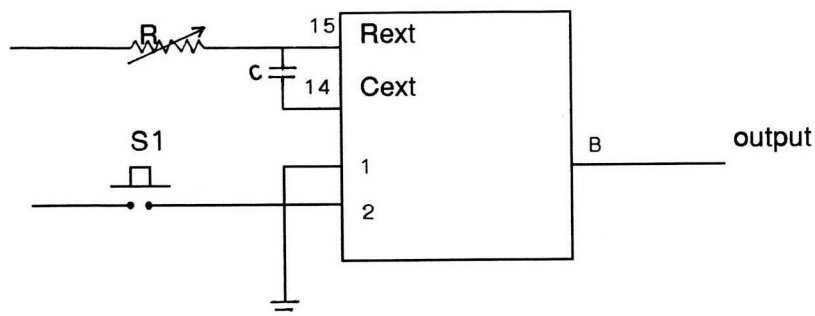


รูปที่ 4.11 ความสัมพันธ์ของเวลากับค่าความจุไฟฟ้าที่ใช้ในวงจรสัญญาณพัลส์ต่อเนื่อง

ในงานวิจัยได้กำหนดค่าเบื้องต้นของ T1 และ T2 ในการออกแบบวงจรคือ 15 และ 10  $\mu\text{s}$  จากการหาค่า C จากกราฟรูปที่ 4.11 ได้ค่าที่เหมาะสมโดยประมาณ คือ 0.047  $\mu\text{F}$  เมื่อคำนวณค่าความต้านทาน Ra และ Rb ตามสมการข้างต้นแล้วจะได้ค่าของ Ra คือ 154  $\Omega$  และ Rb คือ 307  $\Omega$

ในการประกอบวงจรได้ใช้ความต้านทานแบบปรับค่าได้ โดยใช้ Ra 500  $\Omega$  และ Rb 10 k $\Omega$  ซึ่งจะทำให้สามารถปรับค่าความกว้างของพัลส์ขณะมีแรงดันได้ในช่วง 5 - 20  $\mu\text{s}$

2. วงจรกำเนิดสัญญาณพัลส์เดี่ยว เป็นวงจรที่สร้างสัญญาณพัลส์เดี่ยวที่สามารถปรับค่าความกว้างของสัญญาณได้ในช่วง 20-250  $\mu\text{s}$  ในการสร้างวงจรนี้ได้ใช้ TTL เบอร์ 74123 มาต่อให้เป็นวงจรกำเนิดสัญญาณพัลส์เดี่ยว ซึ่งค่าความกว้างของสัญญาณพัลส์ถูกกำหนดด้วยตัวต้านทาน (R) และตัวเก็บประจุ (C) จากภายนอก ที่มาต่อดังในรูปที่ 4.12



รูปที่ 4.12 วงจรกำเนิดสัญญาณพัลส์เดี่ยว

จากการกำหนดเบื้องต้นสำหรับจำนวนพัลส์ที่ต้องการคือจำนวนพัลส์ 10 พัลส์ มีคาบของพัลส์  $25 \mu\text{s}$  และค่าความจุที่เหมาะสม วัตจากกราฟรูปที่ 4.11 ได้ค่าโดยประมาณ คือ  $0.05 \mu\text{F}$  จะสามารถคำนวณค่า R ที่ต้องการใช้ได้ดังสมการ 4.3

$$T = 1.1 RC \quad (4.3)$$

เมื่อ T คือ ความกว้างของพัลส์

R คือ ค่าความต้านทาน

C คือ ค่าความเก็บประจุ

แทนค่า T และ C ลงในสมการได้

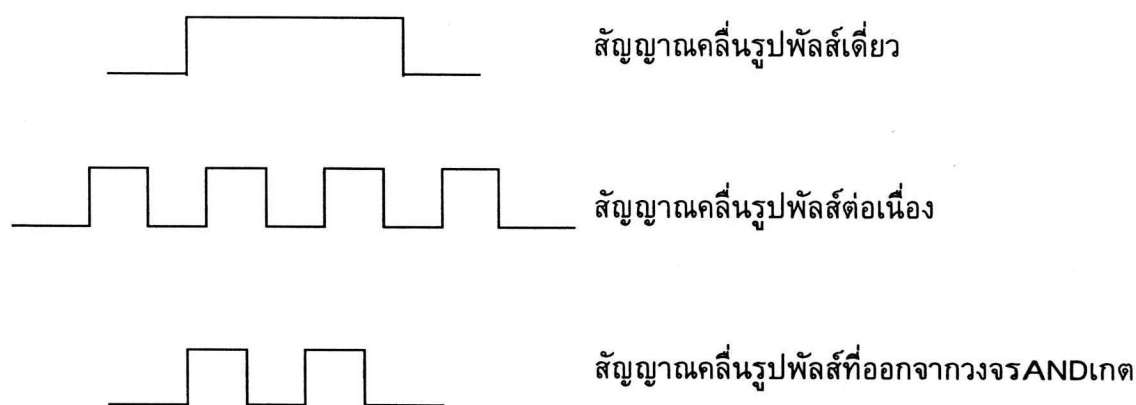
$$R = 250 \times 10^{-6} / 1.1 \times 0.05 \times 10^{-6}$$

$$R = 4545.05 \Omega$$

ในการประกอบวงจรได้ใช้ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ขนาด  $10 \text{ k}\Omega$  เพื่อสามารถที่จะทำการปรับค่าความกว้างของพัลส์ได้มากกว่า  $250 \mu\text{s}$  เป็นผลให้สามารถปรับจำนวนพัลส์ได้มากขึ้นด้วย

หลักการทำงานของวงจร เริ่มจากการกดสวิตช์ S1 จะมีสัญญาณมากระตุ้นที่ขา 2 ของ TTL LS74123 ทำให้วงจรเริ่มทำงาน วงจรที่จะกำเนิดสัญญาณพัลส์เดี่ยวจะออกมาที่ขา 13 ของ TTL LS74123

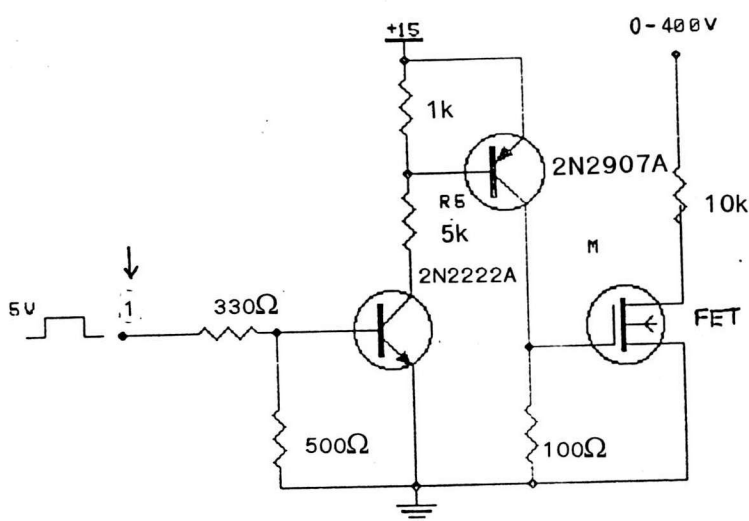
3. วงจรเกต (Gate) เป็นวงจรที่ทำหน้าที่กำหนดจำนวนพัลส์ที่จะไปกระตุ้นเซลล์ใน ห้องบรรจุเซลล์ โดยนำสัญญาณจากวงจรถ่ายเป็นสัญญาณพัลส์เดี่ยวมารวมกับสัญญาณพัลส์ต่อเนื่อง และได้ผลลัพธ์เป็นสัญญาณขาออกดังรูปที่ 4.13 โดยจำนวนพัลส์ที่ออกมาจากวงจร ANDเกต นี้จะมีจำนวนเท่ากับความกว้างของพัลส์เดี่ยวหารด้วยคาบของพัลส์ต่อเนื่อง แสดงรูปของสัญญาณคลื่น รูปที่ 4.13



รูปที่ 4.13 สัญญาณคลื่นรูปพัลส์ก่อนและหลังวงจรเกต

4. วงจรเรียงกระแสตรง (rectifier) เป็นวงจรที่ทำการแปลงสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ 0-380 V ที่ออกมาจากหม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น (Full Bridge Rectifier) และตัวเก็บประจุ สัญญาณที่ได้จากตัวเก็บประจุนี้จะถูกนำไปใช้ในการกระตุ้นเซลล์ โดยไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้มีค่าแรงดันตั้งแต่ 0-400 V

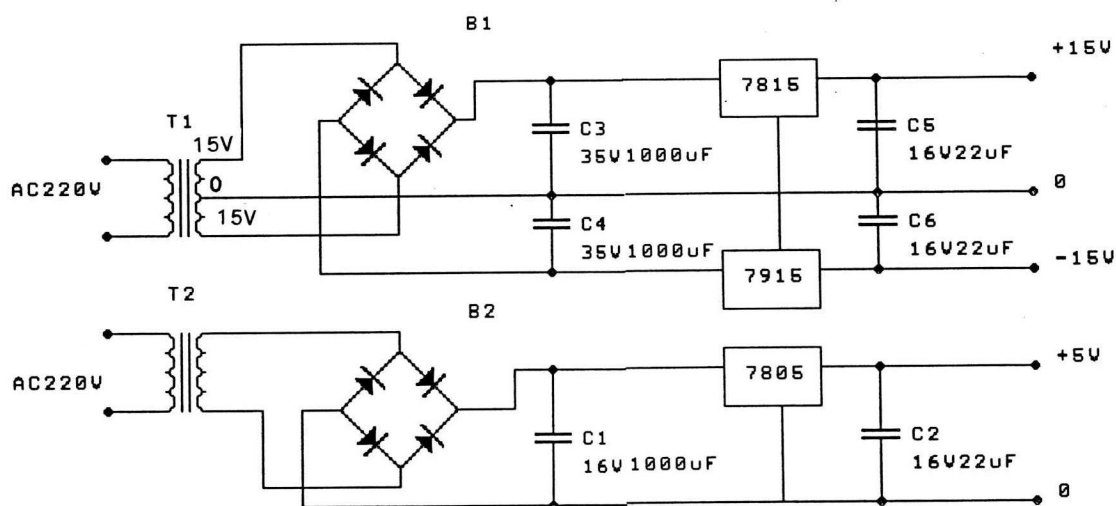
5. วงจรสวิตช์ (Switching) เป็นวงจรที่ทำหน้าที่รับสัญญาณที่ได้จากวงจร AND เกต โดยที่สัญญาณพัลส์จากวงจร AND เกต จะทำหน้าที่สั่งให้ปิดเปิด FET เพื่อให้ผ่านกระแสหรือไม่ผ่านกระแสในช่วงที่ต้องการ



รูปที่ 4.14 ผังวงจรสวิตช์

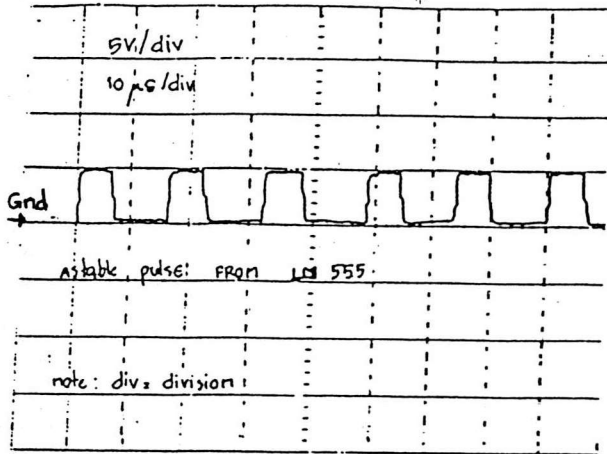
จากรูปที่ 4.14 หลักการทำงานของวงจรเป็นดังนี้คือ เมื่อมีสัญญาณพัลส์ขนาดแรงดัน 5 V เข้าที่ตำแหน่ง 1 ของวงจรจะทำให้ทรานซิสเตอร์ 2N2222A และ 2N2907A ทำงานและส่งสัญญาณพัลส์ไปยัง FET เป็นผลให้ FET ทำงานและแรงดันจากวงจรเรียงกระแสตรงก็จะถูกจ่ายไปให้กับห้องบรรจุเซลล์ในรูปของสัญญาณคลื่นรูปพัลส์แรงดันสูงในกรณีที่ ไม่มีสัญญาณเข้าที่ตำแหน่ง 1 ตัว FET จะไม่ทำงานและจะทำให้ไม่มีสัญญาณคลื่นรูปพัลส์ส่งไปยังห้องบรรจุเซลล์

6. แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง จะประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดัน 5 V เพื่อใช้เลี้ยงวงจรกำเนิดสัญญาณพัลส์เดี่ยว วงจรกำเนิดสัญญาณพัลส์ต่อเนื่อง และวงจรเกตส่วนแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันขนาด 15 V เพื่อจ่ายให้กับวงจรขยาย วงจรที่ใช้เป็นวงจรกระแสตรงทั้งสองชนิดนี้ ทำโดยการใช้วงจรบริดจ์ต่อกับไอซี regulator เบอร์ 7805 และ 7815 เพิ่มเข้าไปเพื่อให้ได้ค่าแรงดัน 5 และ 15 V ที่ขาออกมีค่าคงที่ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.15

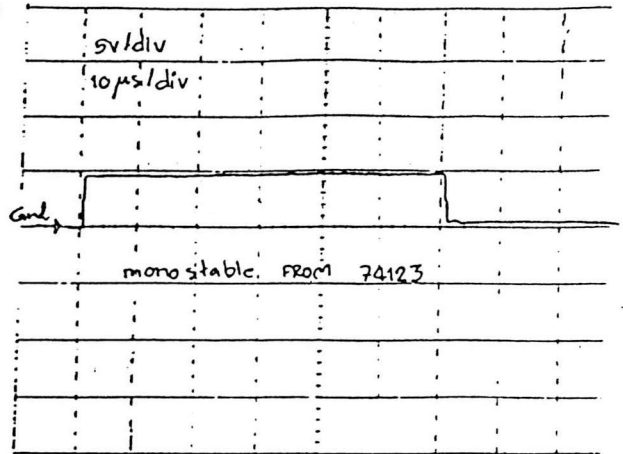


รูปที่ 4.15 ผังวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

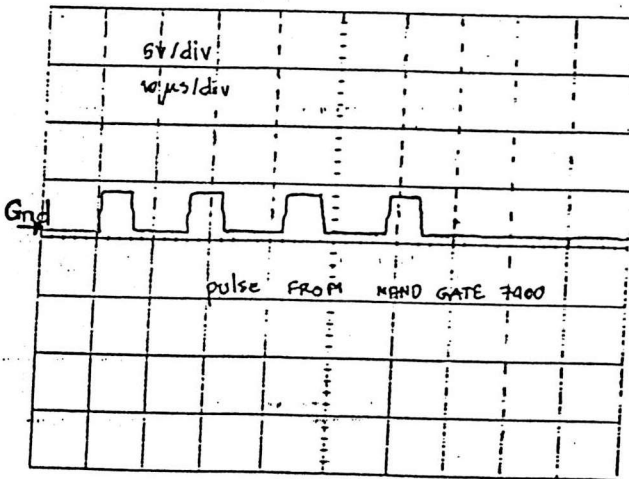
หลังจากประกอบส่วนต่างๆของวงจรกำเนิดสัญญาณเข้าด้วยกันแล้วนำวงจรไปทดสอบสัญญาณที่ได้โดยใช้เครื่องออสซิลอโคป (Oscilloscope, HEMEG HM203-6) แบบบันทึกภาพได้ โดยทำการวัดสัญญาณที่จุด A-E (รูปที่ 4.8) ซึ่งจะได้ผลการทดลองดังแสดงในกราฟรูปที่ 4.16



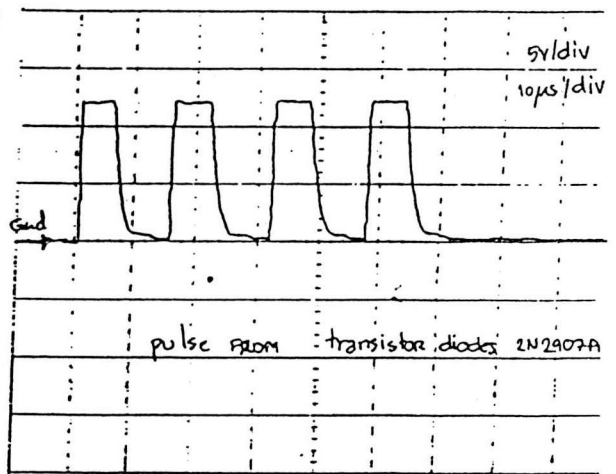
รูปที่ 4.16 ก สัญญาณที่จุด A



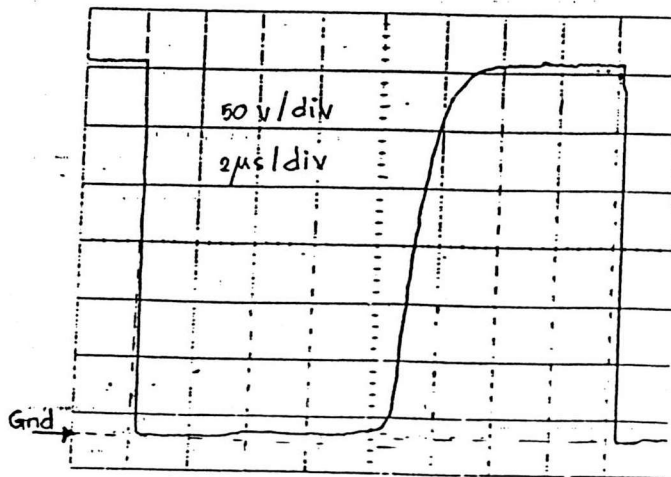
รูปที่ 4.16 ข สัญญาณที่จุด B



รูปที่ 4.16 ค สัญญาณที่จุด C



รูปที่ 4.16 ง สัญญาณที่จุด D



รูปที่ 4.16 จ สัญญาณที่จุด E

รูปที่ 4.16 สัญญาณคลื่นรูปพัลส์จากวงจรกำเนิดพัลส์

### ผลการทดลอง

รูปที่ 4.16ก แสดงสัญญาณที่จุด A เป็นสัญญาณคลื่นรูปพัลส์แบบต่อเนื่องของไอซี LM555 ที่ปรับความกว้างของพัลส์เป็น  $10\ \mu\text{s}$  ขนาดแรงดัน 5 V

รูปที่ 4.16ข แสดงสัญญาณที่จุด B เป็นสัญญาณคลื่นรูปพัลส์เดี่ยวจาก TTL 74123 ที่ปรับความกว้างของพัลส์เป็น  $60\ \mu\text{s}$

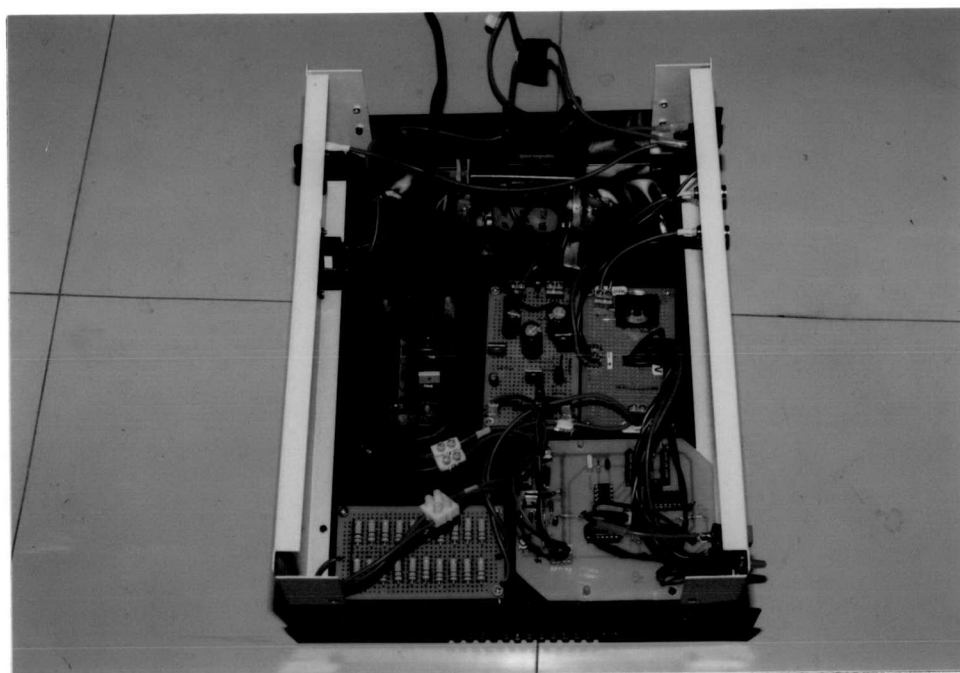
รูปที่ 4.16ค แสดงสัญญาณที่จุด C เป็นสัญญาณคลื่นรูปพัลส์ที่ออกมาจาก TTL 7400 (Nand gate) ซึ่งรวมสัญญาณที่มาจากจุด A และ จุด B ได้สัญญาณจำนวน 4 พัลส์ ขนาดแรงดัน 5 V

รูปที่ 4.16ง แสดงสัญญาณที่จุด D เป็นสัญญาณคลื่นรูปพัลส์ที่วัดได้จากทรานซิสเตอร์ 2N2907A ซึ่งได้สัญญาณพัลส์จำนวน 4 พัลส์ ขนาดแรงดัน 12 V

รูปที่ 4.16จ แสดงสัญญาณที่จุด E เป็นสัญญาณคลื่นรูปพัลส์ที่ออกมาจาก FET IRF 830 ซึ่งทำการเปิดปิดสัญญาณที่มาจากตัวเก็บประจุ (Capacitor) ของวงจรเรียงกระแสตรง ได้ขนาดแรงดันประมาณ 330 V

เมื่อได้สัญญาณคลื่นรูปพัลส์และนำไปประกอบกับส่วนสร้างสัญญาณคลื่นรูปไซน์ส่วนขยายภาพก็จะได้ระบบเครื่องหลอมเซลล์ด้วยไฟฟ้าดังแสดงในรูปที่ 4.17 และ 4.18





รูปที่ 4.17 ลักษณะภายในของเครื่องหลอมเซลล์ด้วยไฟฟ้า



รูปที่ 4.18 ระบบเครื่องหลอมเซลล์ด้วยไฟฟ้า

### 3. ส่วนขยายภาพและแสดงผล

ส่วนขยายภาพและแสดงผลประกอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายของเลนส์ 80 เท่า และกล้องถ่ายภาพกำลังขยาย 1-12 เท่า จะได้ภาพปรากฏที่มีกำลังขยายสูงสุดประมาณ 960 เท่า สัญญาณภาพที่ได้จะแสดงผลทางโทรทัศน์และทำการถ่ายภาพและบันทึกผลขณะทำการกระตุ้นเซลล์ให้มาเรียงตัวและหลอมรวมกันลงบนแถบวีดิทัศน์ ซึ่งภาพของเซลล์ที่มีขนาดประมาณ 5 - 10  $\mu\text{m}$  สามารถมองเห็นได้จากจอโทรทัศน์อย่างชัดเจน